This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-090433

(43) Date of publication of application: 31.03.2000

(51)Int.CI.

G11B 5/84

(21)Application number: 10-252698

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

07.09.1998

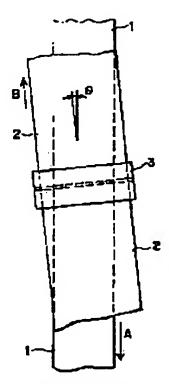
(72)Inventor: RYOMO KATSUMI

(54) PRODUCTION OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to execute good polishing by a smaller number of times of polishing than polishing of a magnetic layer surface of a magnetic recording medium by a polishing tape.

SOLUTION: The tape-like or sheet-like magnetic recording medium 1 having a magnetic layer obtd. by coating the surface of a nonmagnetic base with a magnetic layer coating liquid contg. ferromagnetic powder and a binder, then drying the coating is brought into sliding contact with the polishing tape 2 having a polishing layer contg. polishing powder and a binder, by which the magnetic layer surface is subjected to a surface treatment. At this time, the polishing tape 2 and the magnetic recording medium 1 are brought into sliding



contact with each other by non-paralleling the each other's sliding contact directions of both.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公園番号 特開2000-90433

(P2000-90433A)

(43)公開日 平成12年3月31日(2000.3.31)

(51) IntCL'

識別紀号

FΙ

テーマコート"(参考)

G11B 5/84

G11B 5/84

A 6D112

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出版書号

特惠平10-252898

(22)出題日

平成10年9月7日(1998.9.7)

(71)出憲人 000005201

宮士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中招210番地

(72)発明者 両毛 克己

神奈川県小田原市覇町2丁目12番1号 富

士写真フィルム株式会社内

(74) 代理人 100073184

非理士 柳田 征史 (外1名)

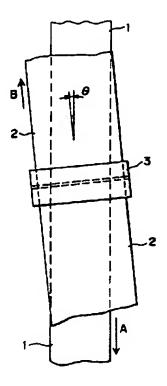
Fターム(参考) 5D112 AA22 GA13 GA14

(54) [発明の名称] 磁気配量単体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 磁気記録媒体の磁性層表面を研磨テープによ り研磨するについて少ない研磨回数によって良好な研磨 が行えるようにする。

【解決手段】 強磁性粉末と結合剤を含む磁性層強布液 を非磁性支持体上に強設した後、乾燥し、得られた磁性 層を有するテープ状又はシート状態気配録媒体1を、研 磨粉体と結合剤を含む研磨層を有する研磨テープ2と摺 接させて前記磁性層表面を表面処理するについて、研磨 テープ2と磁気記録媒体1とを互いの個接方向を非平行 として摺接させる.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 強磁性粉末と結合剤を含む磁性層盤布液を非磁性支持体上に塗設した後、乾燥し、得られた磁性層を有するテープ状又はシート状態気記録媒体を、研磨粉体と結合剤を含む研磨層を有する研磨テープと摺接させて前記磁性層表面を表面処理する磁気記録媒体の製造方法において、

前記研磨テープと前記磁気記録媒体とを互いの摺接方向 を非平行として摺接させることを特徴とする磁気記録媒 体の製造方法。

【請求項2】 前記研磨テープの研磨層が、研磨粉体に ダイヤモンドを含むことを特徴とする請求項1に記載の 磁気記録媒体の製造方法。

【請求項3】 前記研磨粉体のうちダイヤモンドが研磨 粉体全体の50%以上をしめることを特徴とする請求項 2に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項4】 前記研磨テーアの全厚みが2~100μmであることを特徴とする請求項2に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項5】 前記磁気記録媒体の磁性層の厚みが0.05~3.5μmであることを特徴とする請求項1に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項6】 前記磁気記録媒体の磁性層の強磁性粉末 が金属粉末からなることを特徴とする請求項1記載の磁 気記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テープ状又はシート状磁気記録媒体の磁性層表面を研磨テープにより表面処理する磁気記録媒体の製造方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】磁気記録媒体は、非磁性支持体上に金属粉や酸化鉄などの強磁性粉末を結合剤と称される結合剤に分散した磁性層塗布液を強設し、乾燥、硬化させたのち、カレンダー処理を施して所定幅にスリットし生産する。乾燥処理が終わった後の工程で磁気記録媒体表面のクリーニング等の表面処理を行う。上記表面処理は、不緻布、ティシュペーパーによるクリーニング、又は、酸化アルミナや酸化クロム、炭化珪素等の研磨剤を含む研磨テープなどによる研磨が行われている。

【0003】例えば、特別昭63-259830号に、 磁気記録媒体の磁性層をカレンダーによる表面平滑化処理した後、該磁性層の表面を研磨テープにより研磨処理 する技術が開示されている。

【0004】つまり、磁気記録媒体の磁性層表面には、 固定不十分な強磁性粉末などの粒状成分が存在し、この 固定不十分な粒状成分が磁気記録媒体の走行中に脱離し て磁気ヘッドに付着し、目詰まりの原因となって出力低 下を招く、また、前記磁性層表面の固定不十分な粒状成 分により表面相さが大きくなって、磁気ヘッド表面の磨 耗を生起する同題も有する。

【0005】そして、上記磁性層表面に固定不十分な粒 状成分の除去のための表面処理は、短時間で行うことは 極めて困難で、金属の刃や超硬の刃を用いたブレード処 理では、応分の時間、複数回の処理を必要とし、この点 研磨テープの摺接による表面処理は有効である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかして、前述のような研磨テープによる磁気記録媒体の研磨においては、互いの摺接方向が平行であることで良好な表面処理が行えず、複数回の研磨を必要とし効率が低かった。

【0007】例えば、前記研磨テープは、研磨粉体と結合剤を含む塗布液を支持体上に塗設して研磨層を設けるものであるが、上記塗布液をバーコート塗布により塗設した際には、研磨層表面には走行方向に延びるバーすじが発生しやすい。このバーすじを有する研磨層を前記磁性層表面に平行に接触させると、この研磨層の凹凸に対応した凹凸形状に、除去が必要であるのに除去されない粒子成分が残り、この磁気記録媒体を使用した際の磁気へッドの磨耗、目詰まりの抑制作用が不十分となり、複数回の研磨テープによる表面処理が必要とされる。

【0008】そこで、本発明は上記点に鑑みなされたものであって、磁気記録媒体の磁性層表面を研磨テープにより研磨するについて少ない研磨回数によって良好な表面処理が行え、磁気ヘッドの磨耗及び目詰まりの発生を抑制し得る磁気記録媒体の製造方法を提供せんとするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決した本発明の磁気記録媒体の製造方法は、強磁性粉末と結合剤を含む磁性層塗布液を非磁性支持体上に塗設した後、乾燥し、得られた磁性層を有するテープ状又はシート状磁気記録媒体を、研磨粉体と結合剤を含む研磨層を有する研磨テープと摺接させて前記磁性層表面を表面処理するについて、前記研磨テープと前記磁気記録媒体とを互いの摺接方向を非平行として摺接させることを特徴とするものである。

【0010】また、前記磁性層表面に摺接させる研磨テープの研磨層が、研磨粉体にダイヤモンドを含むことが望ましい。この場合、前記研磨粉体のうちダイヤモンドが研磨粉体全体の50%以上をしめるのが好適である。また、前記ダイヤモンドを含む研磨テープの全厚みが2~100μmであるのが好適である。

【0011】一方、前記磁気記録媒体は、磁性層の厚みが0.05~3.5μmであるものが好ましい。また、前記磁性層の強磁性粉末が金属粉末からなるものが好適である。

【0012】なお、前記磁気記録媒体と研磨テープとの 摺接は完全に平行でさえなければ良く、僅かでも角度を つけた非平行で階接させればよいもので、具体的には両 者の摺接角度は90°未満であれば良く、好ましくは2~70°、例えばう°の角度で摺接させる。

[0013]

【発明の効果】上記のような本発明によれば、磁性層を 有するテープ状又はシート状磁気記録媒体の磁性層表面 を、研磨粉体と結合剤を含む研磨層を有する研磨テープ と摺接させて表面処理するとき、研磨テープと磁気記録 媒体とを互いの摺接方向を非平行として摺接させたこと により、磁性層の表面処理を効率的に行って短時間で磁 性層表面の不要な粒状成分が除去でき、磁気ヘッドの磨 耗、目詰まりの発生の少ない、特性の優れたテープ状又 はシート状磁気記録媒体を製造することができる。

【0014】また、前記研磨テーアの研磨粉体がダイヤモンドを例えば50%以上含むものでは研磨力が高く、特に良好な研磨が少ない処理回数で行える。

【0015】特に本発明は、バーコート塗布により研磨層を塗設した研磨テープを使用するものにおいて有効であり、バーコート塗布に伴うバーすじが研磨層表面に発生していても、前記摺接方向が非平行であることで、研磨テープは相対的に磁性層の幅方向に移動しつつ摺接し、研磨後の磁性層表面には上記バーすじの凹凸に伴う除去不足の粒状成分が残ることなく除去できるものである。

[0016]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の磁気記録媒体の 製造方法の実施の形態を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

【0017】本発明の磁気記録媒体の製造方法は、強磁性金属粉末と結合剤を含む磁性層域布液を非磁性支持体上に塗設した後、乾燥し、得られた厚みが0.05~3.5μmである磁性層を有するテープ状又はシート状磁気記録媒体を所定幅にスリットしたあと、ダイヤモンド等を研磨粉体全体の50%以上含む研磨粉体と結合剤を含む研磨層を有する全厚みが2~100μmである研磨テープと構接させて前記磁性層表面を表面処理するとき、研磨テープと磁気記録媒体との互いの摺接方向を平行とならないように非平行として角度をもたせて摺接させるものである。

【0018】図1に上記研磨状態を示し、テープ状又はシート状盤気記録媒体1を矢印Aの方向に走行させ、一方、研磨テープ2を上記矢印Aと反対方向の矢印Bの方向に走行させ、この研磨テープ2の背面側にパッド3を配設して、該研磨テープ2の研磨層表面を前記磁気記録媒体1の磁性層表面に接触させて、両者の控動により研磨処理を行う。その際、磁気記録媒体1の走行方向Aと磁気テープ2の走行方向Bとは平行ではなく、所定の角度のをもって非平行状態で摺接させるもので、上記角度のは、90°未満、好ましくは2°~70°、例えば5つに設定する。

【0019】前記磁気記録媒体は、上記のように非磁性

支持体上に強磁性粉末を結合剤に分散した磁性層を設けてなるもので、一方、研磨テープは、可撓性支持体上に、研磨粉体を結合剤に分散した研磨層を設けてなるものであり、両者の支持体は以下に示すような素材で形成され、磁性層又は研磨層は以下に示すような素材による結合剤に、磁性層では下記の強磁性粉末を、研磨層では下記の研磨粉体をその他の添加剤と共に配合した磁性用塗布液又は研磨層用塗布液を上記支持体上に塗設してなるものであり、基本的な製造技術は同様である。

【0020】本発明の磁気記録媒体における磁性層で用 いられる強磁性粉末は、アーFeOx(x=1.33~ 1.5)、Co変性r-FeOx(x=1.33~1.5)、α-FeまたはNiまたはCoを主成分(75% 以上)とする強磁性合金粉末、バリウムフェライト、ス トロンチウムフェライトなど公知の強磁性粉末が使用で きるが、α-Γeを主成分とする強磁性合金粉末が好ま しい。これらの強磁性粉末には所定の原子以外に、A I, Si, S, Sc, Ca, Ti, V, Cr, Cu, Y, Mo, Rh, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, B a, Ta, W, Re, Au, Hg, Pb, Bi, La, Ce, Pr. Nd, P. Co, Mn, Zn, Ni, S r. B. Mgなどの原子を含んでもかまわない。特に、 メタル磁性体の場合はAl, Si, Ca, Y, Ba, L a, Nd, Co, Ni, Bがα-Fe以外に含まれる元 素として重要である。とりわけ、Si, Al, Yが表面 処理や焼結防止剤として重要である。CoはFeに対し 2~40重量%含有したものが好ましい。Si、AI、 Yは0~10重量%の間で含まれる。これらの強磁性粉 末には後で述べる分散剤、潤滑剤、界面活性剤、帯電防 止剤などで分散前にあらかじめ処理を行ってもかまわな い、具体的には、特公昭44-14090号、特公昭4 5-18372号、特公昭47-22062号、特公昭 47-22513号、特公昭46-28466号、特公 昭46-38755号、特公昭47-4286号、特公 昭47-12422号、特公昭47-17284号、特 公昭47−18509号、特公昭47−18573号、 特公昭39-10307号、特公昭48-39639 号、米国特許3026215号、同3031341号、 同3100194号、同3242005号、同3389 014号などに記載されている.

【0021】上記強磁性粉末の中で強磁性合金微粉末については少量の水酸化物、または酸化物を含んでもよい。強磁性合金微粉末の公知の製造方法により得られたものを用いることができ、下記の方法を挙げることができる。複合有機酸塩(主としてシュウ酸塩)と水素などの選元性気体で還元する方法、酸化鉄を水素などの還元性気体で還元してFeあるいはFe-Co粒子などを得る方法、金属カルボニル化合物を熱分解する方法、強磁性金属の水溶液に水素化ホウ素ナトリウム、次亜リン酸塩あるいはヒドラジンなどの還元剤を添加して還元する

方法、金属を低圧の不活性気体中で蒸発させて微粉末を 得る方法などである。このようにして得られた強磁性合 金粉末は公知の除酸化処理、すなわち有機溶剤に浸漬し たのち乾燥させる方法、有機溶剤に浸漬したのち酸素含 有ガスを送り込んで表面に酸化膜を形成したのち乾燥さ せる方法、有機溶剤を用いず酸素ガスと不活性ガスの分 圧を調整して表面に酸化皮膜を形成する方法のいずれを 能したものでも用いることができる。

【0022】前記磁性層の強磁性粉末をBET法による 比表面積で表せば45~80㎡/gであり、好ましく は50~70㎡/gである。40㎡/g以下または8 0㎡/g以上では表面性が得にくく好ましくない。本 発明の磁性層の強磁性粉末の結晶子サイズは300~1 00Aであり、好ましくは250~100A、更に好ま しくは200~140Aである。

【0023】強磁性粉末の飽和磁化σs は100~18 Oemu/g が好ましく、さらに好ましくは110~170 emu/g、更に好ましくは125~160emu/g である。強磁性粉末の抗磁力Hcは500~3000eが好ましい。角型比は0.6~0.98が好ましく、磁性層の磁化量は0.03~0.3がウス・cmが好ましい。一方、強磁性粉末の針状比は4~18が好ましく、更に好ましくは5~12である。強磁性粉末の含水率は0.01~2%とするのが好ましい。結合剤の種類によって強磁性粉末の含水率は最適化するのが好ましい。

【0024】強磁性粉末のpHは用いる結合剤との組み合わせにより最適化することが好ましい。その範囲は4~12であるが、好ましくは6~10である。強磁性粉末は必要に応じ、Al,Si,Pまたはこれらの酸化物などで表面処理を施してもかまわない。その量は強磁性粉末に対し0.1~10%であり表面処理を施すと脂肪酸などの潤滑剤の吸着が100mg/m²以下になり好ましい。強磁性粉末には可溶性のNa,Ca,Fe,Ni,Srなどの無機イオンを含む場合がある。これらは、本質的に無い方が好ましいが、200ppm以下であれば特に特性に影響を与えることは少ない。また、強磁性粉末は空孔が少ないほうが好ましくその値は20容量%以下、さらに好ましくは5容量%以下である。

【0025】本発明の研磨テーアにおける研磨層で用いられる研磨粉体は、構成される研磨粉体の50重量%以上がダイヤモンドであり、残りは一般的に研磨作用者しくは琢磨作用をもつ材料で、αーアルミナ、ァーアルミナ、α、ァーアルミナ、熔酸アルミナ、炭化建業、酸化クロム、酸化セリウム、コランダム、α一酸化鉄、ザクロ石、エメリー(主成分:コランダムと磁鉄鉱)、ガーネット、珪石、窒化建業、窒化端業、炭化モリブデン、炭化硼素、炭化タングステン、チタンカーバイド、トリボリ、ケイソウ土、ドロマイト等で、主としてモース硬度6以上の材料が1内至4種迄の組み合わせで使用できる。これらの研磨粉体は平均粒子サイズが0.005~

100μmの大きさのものが使用され、特に好ましくは 0.01~50μmである。これらの研磨粉体は、研磨 層の場合研磨粉体100重量部に対して結合剤0.1~ 50重量部の範囲で用いられる。

【0026】前記ダイヤモンドは、人工ダイヤモンド、 天然ダイヤモンド等の分級品を用いることができる。これらのダイヤモンドの結晶は単結晶、多結晶いずれでも 構わない。またCVD(化学蒸気沈積法)で作成したダイヤモンドでも良い。ダイヤモンドの表面は、金属合金 や有機系の樹脂で被覆してあっても良い。

【0027】またその他の研磨粉体の具体例としては、住友化学社製のAKP1、AKP15、AKP20、AKP30、AKP50、AKP80、Hit50、Hit100等が挙げられる。これらについては特公昭52-28642号、特公昭49-39402号、特開昭63-98828号、米国特許3687725号、米国特許3007807号、米国特許3041196号、米国特許3293066号、米国特許3630910号、米国特許3833412号、米国特許3630910号、米国特許3833412号、米国特許4117190号、英国特許1145349号、西独特許853211号等に記載されている。

【0028】本発明の磁気記録媒体の磁性層又は研磨テープの研磨層に使用される結合剤としては、従来公知の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、反応型樹脂、電子線硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂、可視光線硬化型樹脂やこれらの混合物が使用される。

【0029】熱可塑性樹脂としては、軟化温度が150 ℃以下、平均分子量が10000~300000、重合 度が約50~2000程度のものでより好ましくは20 0~600程度である。例えば塩化ビニル酢酸ビニル共 重合体、塩化ビニル共重合体、塩化ビニル酢酸ビニルビ ニルアルコール共重合体、塩化ビニルビニルアルコール 共重合体、塩化ビニル塩化ビニリデン共重合体、塩化ビ ニルアクリロニトリル共重合体、アクリル酸エステルア クリロニトリル共重合体、アクリル酸エステル塩化ビニ リデン共重合体、アクリル酸エステルスチレン共重合 体、メタクリル酸エステルアクリロニトリル共重合体、 メタクリル酸エステル塩化ビニリデン共重合体、メタク リル酸エステルスチレン共重合体、ウレタンエラストマ 一、ナイロンーシリコン系樹脂、ニトロセルロースーポ リアミド樹脂、ポリフッカビニル、塩化ビニリデンアク リロニトリル共重合体、ブタジエンアクリロニトリル共 重合体、ポリアミド樹脂、ポリピニルブチラール、セル ロース誘導体(セルロースアセテートブチレート、セル ロースダイアセテート、セルローストリアセテート、セ ルロースプロピオネート、ニトロセルロース、エチルセ ルロース、メチルセルロース、プロピルセルロース、メ チルエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、 アセチルセルロース等)、スチレンブタジエン共重合 体、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、クロロ ビニルエーテルアクリル酸エステル共**重合体、アミノ樹脂、各種の合成ゴム系の熱可塑性樹脂及びこれらの混合物等が使用される**。

【0030】これらの樹脂の例示は、特公昭37-68 77号、待公昭39-12528号、特公昭39-19 282号、特公昭40-5349号、特公昭40-20 907号、特公昭41-9463号、特公昭41-14 059号、特公昭41-16985号、特公昭42-6 428号、特公昭42-11621号、特公昭43-4 523号、特公昭43-15206号、特公昭44-2 889号、特公昭44-17947号、特公昭44-1 8232号、特公昭45-14020号、特公昭45-14500号、特公昭47-18573号、特公昭47 -22063号、特公昭47-22064号、特公昭4 7-22068号、特公昭47-22069号、特公昭 47-22070号、特公昭47-27886号、特開 昭57-133521号、特開昭58-137133 号、特開昭58-166533号、特開昭58-222 433号、特開昭59-58642号等、米国特許45 71364号、米国特許4752530号の公報等に記 載されている.

【0031】熱硬化性樹脂又は反応型樹脂としては、塗 布液の状態では20000以下の分子量であり、塗 布、乾燥後に加熱加湿することにより、縮合、付加等の 反応により分子量が無限大となるものが好適である。ま た、これらの樹脂のなかで、樹脂が熱分解するまでの間 に軟化又は溶融しないものが好ましい。具体的には例え ばフェノール樹脂、フェノキシ樹脂、エボキシ樹脂、ボ リウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタンポリ カーボネート樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッ ド樹脂、シリコン樹脂、アクリル系反応樹脂(電子線硬 化樹脂)、エボキシーポリアミド樹脂、ニトロセルロー スメラミン樹脂、高分子量ポリエステル樹脂とイソシア ネートプレポリマーの混合物、メタクリル酸塩共重合体 とジイソシアネートプレポリマーの混合物、ポリエステ ルポリオールとポリイソシアネートとの混合物、尿素ホ ルムアルデヒド樹脂、低分子量グリコール/高分子量ジ オール/トリフェニルメタントリイソシアネートの混合 物、ポリアミン樹脂、ポリイミン樹脂及びこれらの混合 物等である。

【0032】これらの樹脂の例示は特公昭39-8103号、特公昭40-9779号、特公昭41-7192号、特公昭41-8016号、特公昭41-14275号、特公昭42-18179号、特公昭43-12081号、特公昭44-28023号、特公昭45-14501号、特公昭45-24902号、特公昭45-13103号、特公昭47-22065号、特公昭47-22066号、特公昭47-22067号、特公昭47-22073号、特公昭47-28045号、特公昭47-28045号、特公昭47-28045号、特公昭47-28048号、特公昭47-28048号、特公昭47-28048号、特公昭4

7-28922号等の公報に記載されている。

【0033】これらの熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、反 応型樹脂は、主たる官能基以外に官能基としてカルボン 酸(COOM)、スルフィン酸、スルフェン酸、スルホ ン酸(SO₃M)、燐酸(PO(OM)(OM))、ホスホ ン酸、硫酸(OSO₃M)、及びこれらのエステル基等 の酸性基(MはH、アルカリ金属、アルカリ土類金属、 炭化水素基)、アミノ酸類;アミノスルホン酸類、アミ ノアルコールの硫酸又は燐酸エステル類、アルキルペタ イン型等の両性類基、アミノ基、イミノ基、イミド基、 アミド基等、また、水酸基、アルコキシル基、チオール 基、アルキルチオ基、ハロゲン基(F、CI、Br、 I)、シリル基、シロキサン基、エポキシ基、イソシア ナト基、シアノ基、ニトリル基、オキソ基、アクリル 基、フォスフィン基を通常1種以上6種以内含み、各々 の官能基は樹脂1gあたり1×10-6eq~1×10-2 e q 含むことが好ましい。

【0034】これらの結合剤の単独又は組合わされたものが使われ、ほかに添加剤が加えられる。前記添加剤としては分散剤、潤滑剤、研磨粉体、帯電防止剤、酸化防止剤、溶剤等が加えられる。

【0035】本発明の磁性圏又は研磨層に用いるポリイソシアネートとしては、トリレンジイソシアネート、4・4'ージフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ウートルイジンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、カリフェニルメタントリイソシアネート、ガリイソシアネート類、当該イソシアネート類とポリアルコールとの生成物、イソシアネート類の縮合によって生成した2~10量体のポリイソシアネート、ポリイソシアネートとポリウレタンとの生成物で末端官能差がイソシアネートとポリウレタンとの生成物で末端官能差がイソシアネートであるもの等を使用することができる。これらポリイソシアネート類の平均分子量は100~20000のものが好適である。

 組み合わせによって使用することができる。

【0037】また、硬化反応を促進する目的で、水酸基(ブタンジオール、ヘキサンジオール、分子量が1000~1000のボリウレタン、水等)、アミノ基(モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン等)を有する化合物や金属酸化物の触媒や鉄アセチルアセトネート等の触媒を併用することもできる。これらの水酸基やアミノ基を有する化合物は多官能であることが望ましい。これらボリイソシアネートは磁性層、研磨層、バック層とも結合削樹脂とボリイソシアネートの総量100重量部あたり2~70重量部で使用することが好ましく、より好ましくは5~50重量部である。これらの例示は特開昭60-131622号、特開昭61-74138号等の公報において示されている。

【0038】本発明の磁性層又は研磨層に使用される粉末状潤滑剤としては、グラファイト、二硫化モリブデン、窒化硼素、弗化黑鉛、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化珪素、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫、二硫化タングステン等の無機微粉末、アクリルスチレン系樹脂微粉末、ベンゾグアナミン系樹脂微粉末、メラミン系樹脂微粉末、ボリオレフイン系樹脂微粉末、ボリエステル系樹脂微粉末、ボリアミド系樹脂微粉末、ボリイミド系樹脂微粉末、ボリフッカエチレン系樹脂微粉末等の樹脂微粉末等がある。

【0039】また有機化合物系潤滑剤としては、シリコ ンオイル (ジアルキルポリシロキサン、ジアルコキシポ リシロキサン、フェニルポリシロキサン、フルオロアル キルポリシロキサン(信越化学社製KF96、KF69 等))、脂肪酸変性シリコンオイル、フッ素アルコー ル、ポリオレフィン(ポリエチレンワックス、ポリプロ ピレン等)、ポリグリコール(エチレングリコール、ポ リエチレンオキシドワックス等)、テトラフルオロエチ レンオキシドワックス、ポリテトラフルオログリコー ル、パーフルオロアルキルエーテル、パーフルオロ脂肪 酸、パーフルオロ脂肪酸エステル、パーフルオロアルキ ル硫酸エステル、パーフルオロアルキルスルホン酸エス テル、パーフルオロアルキルベンゼンスルホン酸エステ ル、パーフルオロアルキル燐酸エステル等の弗素や珪素 を導入した化合物、アルキル硫酸エステル、アルキルス ルホン酸エスデル、アルキルホスホン酸トリエステル、 アルキルホスホン酸モノエステル、アルキルホスホン酸 ジエステル、アルキル傾触エステル、琥珀酸エステル等 の有機酸及び有機酸エステル化合物、トリアザインドリ ジン、テトラアザインデン、ベンゾトリアゾール、ペン ゾトリアジン、ベンゾジアゾール、EDTA等の登業・ 硫黄を含む複素(ヘテロ)環化合物、炭素数10~40 の一塩基性脂肪酸と炭素数2~40個の一個のアルコー ルもしくは二倍のアルコール、三倍のアルコール、四佰 のアルコール、六価のアルコールのいずれか1つもしく は2つ以上とからなる脂肪酸エステル類、炭素数10個

以上の一塩基性脂肪酸と該脂肪酸の炭素数と合計して炭素数が11~70個となる一個~六個のアルコールからなる脂肪酸エステル類、炭素数8~40の脂肪酸或いは脂肪酸アミド類、脂肪酸アルキルアミド類、脂肪族アルコール類も使用できる。

【0040】これら化合物の具体的な例としては、カア リル酸ブチル、カプリル酸オクチル、ラウリン酸エチ ル、ラウリン酸ブチル、ラウリン酸オクチル、ミリスチ ン酸エチル、ミリスチン酸プチル、ミリスチン酸オクチ ル、ミリスチン酸2エチルヘキシル、パルミチン酸エチ ル、パルミチン酸プチル、パルミチン酸オクチル、パル ミチン酸2エチルヘキシル、ステアリン酸エチル、ステ アリン酸ブチル、ステアリン酸イソブチル、ステアリン 酸オクチル、ステアリン酸2エチルヘキシル、ステアリ ン酸アミル、ステアリン酸イソアミル、ステアリン酸2 エチルペンチル、ステアリン酸2ヘキシルデシル、ステ アリン酸イソトリデシル、ステアリン酸アミド、ステア リン酸アルキルアミド、ステアリン酸ブトキシエチル、 アンヒドロソルビタンモノステアレート、アンヒドロソ ルビタンジステアレート、アンヒドロソルビタントリス テアレート、アンヒドロソルビタンテトラステアレー ト、オレイルオレート、オレイルアルコール、ラウリル アルコール、モンタンワックス、カルナウバワックス等 があり単独若しくは粗み合わせ使用できる。

【0041】また本発明に使用される潤滑剤としては、 潤滑油添加剤も単独若しくは粗み合わせで使用でき、防 **錆剤として知られている酸化防止剤(アルキルフェノー** ル、ベンゾトリアジン、テトラアザインデン、スルファ ミド、グアニジン、核酸、ピリジン、アミン、ヒドロキ ノン、EDTA等の金属キレート剤)、錆どめ剤(ナフ テン酸、アルケニルコハク酸、燐酸、ジラウリルフォス フェート等)、油性剤(ナタネ油、ラウリルアルコール 等)、極圧剤(ジベンジルスルフィド、トリクレジルフ ォスフェート、トリブチルホスファイト等)、清浄分散 剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、泡どめ剤等があ る。これらの潤滑剤は結合剤100重量部に対して0. 01~30重量部の範囲で添加される。これらについて は、特公昭43-23889号、特公昭48-2404 1号、特公昭48-18482号、特公昭44-182 21、特公昭47-28043号、特公昭57-561 32、特開昭59-8136号、特開昭59-8139 号、特開昭61-85621号、米国特許342323 3号、米国特許3470021号、米国特許34922 35号、米国特許3497411号、米国特許3523 086号、米国特許3625760号、米国特許363 0772号、米国特許3634253号、米国特許36 42539号、米国特許3687725号、米国特許4 135031号、米国特許4497864号、米国特許 4552794号、アイビーエムテクニカル ディスク ロジャーブリテン (IBM Technical Di

組み合わせによって使用することができる。

【0037】また、硬化反応を促進する目的で、水酸基(ブタンジオール、ヘキサンジオール、分子量が1000~1000のボリウレタン、水等)、アミノ基(モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン等)を有する化合物や金属酸化物の触媒や鉄アセチルアセトネート等の触媒を併用することもできる。これらの水酸基やアミノ基を有する化合物は多官能であることが望ましい。これらボリイソシアネートは磁性層、研磨層、バック層とも結合剤樹脂とボリイソシアネートの総量100重量部あたり2~70重量部で使用することが好ましく、より好ましくは5~50重量部である。これらの例示は特開昭60~131622号、特開昭61~74138号等の公報において示されている。

【0038】本発明の磁性層又は研磨層に使用される粉末状潤滑剤としては、グラファイト、二硫化モリブデン、窒化硼素、弗化黑鉛、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化珪素、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫、二硫化タングステン等の無機微粉末、アクリルスチレン系樹脂微粉末、ベンゾグアナミン系樹脂微粉末、メラミン系樹脂微粉末、ポリオレフイン系樹脂微粉末、ポリエステル系樹脂微粉末、ポリアミド系樹脂微粉末、ポリイミド系樹脂微粉末、ポリフッカエチレン系樹脂微粉末等の樹脂微粉末等がある。

【0039】また有機化合物系潤清剤としては、シリコ ンオイル(ジアルキルポリシロキサン、ジアルコキシボ リシロキサン、フェニルポリシロキサン、フルオロアル キルポリシロキサン (信越化学社製KF96、KF69 等))、脂肪酸変性シリコンオイル、フッ素アルコー ル、ポリオレフィン(ポリエチレンワックス、ポリプロ ピレン等)、ポリグリコール(エチレングリコール、ポ リエチレンオキシドワックス等)、テトラフルオロエチ レンオキシドワックス、ポリテトラフルオログリコー ル、パーフルオロアルキルエーテル、パーフルオロ脂肪 酸、パーフルオロ脂肪酸エステル、パーフルオロアルキ ル硫酸エステル、パーフルオロアルキルスルホン酸エス テル、パーフルオロアルキルベンゼンスルホン酸エステ ル、パーフルオロアルキル燐酸エステル等の弗素や珪素 を導入した化合物、アルキル硫酸エステル、アルキルス ルホン酸エステル、アルキルホスホン酸トリエステル、 アルキルホスホン酸モノエステル、アルキルホスホン酸 ジエステル、アルキル燐酸エステル、琥珀酸エステル等 の有機酸及び有機酸エステル化合物、トリアザインドリ ジン、テトラアザインデン、ベンゾトリアゾール、ベン ゾトリアジン、ベンゾジアゾール、EDTA等の窒素・ 競費を含む複素(ヘテロ)環化合物、炭素数10~40 の一塩基性脂肪酸と炭素数2~40個の一個のアルコー ルもしくは二倍のアルコール、三倍のアルコール、四値 のアルコール、六価のアルコールのいずれか1つもしく は2つ以上とからなる脂肪酸エステル類、炭素数10個 以上の一塩基性脂肪酸と該脂肪酸の炭素数と合計して炭素数が11~70個となる一価~六価のアルコールからなる脂肪酸エステル類、炭素数8~40の脂肪酸或いは脂肪酸アミド類、脂肪酸アルキルアミド類、脂肪族アルコール類も使用できる。

【0040】これら化合物の具体的な例としては、カブ リル酸ブチル、カプリル酸オクチル、ラウリン酸エチ ル、ラウリン酸ブチル、ラウリン酸オクチル、ミリスチ ン酸エチル、ミリスチン酸ブチル、ミリスチン酸オクチ ル、ミリスチン酸2エチルヘキシル、パルミチン酸エチ ル、パルミチン酸ブチル、パルミチン酸オクチル、パル ミチン酸2エチルヘキシル、ステアリン酸エチル、ステ アリン酸ブチル、ステアリン酸イソブチル、ステアリン 酸オクチル、ステアリン酸2エチルヘキシル、ステアリ ン酸アミル、ステアリン酸イソアミル、ステアリン酸2 エチルペンチル、ステアリン酸2ヘキシルデシル、ステ アリン酸イソトリデシル、ステアリン酸アミド、ステア リン酸アルキルアミド、ステアリン酸プトキシエチル、 アンヒドロソルビタンモノステアレート、アンヒドロソ ルビタンジステアレート、アンヒドロソルビタントリス テアレート、アンヒドロソルビタンテトラステアレー ト、オレイルオレート、オレイルアルコール、ラウリル アルコール、モンタンワックス、カルナウバワックス等 があり単独若しくは組み合わせ使用できる。

【0041】また本発明に使用される潤滑剤としては、 潤滑油添加剤も単独若しくは組み合わせで使用でき、防 鎬剤として知られている酸化防止剤(アルキルフェノー ル、ベンゾトリアジン、テトラアザインデン、スルファ ミド、グアニジン、核酸、ピリジン、アミン、ヒドロキ ノン、EDTA等の金属キレート剤)、錆どめ剤(ナフ テン酸、アルケニルコハク酸、燐酸、ジラウリルフォス フェート等)、油性剤(ナタネ油、ラウリルアルコール 等)、極圧剤(ジベンジルスルフィド、トリクレジルフ ォスフェート、トリプチルホスファイト等)、清浄分散 剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、泡どめ剤等があ る。これらの潤滑剤は結合剤100重量部に対して0. 01~30重量部の範囲で添加される。これらについて は、特公昭43-23889号、特公昭48-2404 1号、特公昭48-18482号、特公昭44-182 21、特公昭47-28043号、特公昭57-561 32、特開昭59-8136号、特開昭59-8139 号、特開昭61-85621号、米国特許342323 3号、米国特許3470021号、米国特許34922 35号、米国特許3497411号、米国特許3523 086号、米国特許3625760号、米国特許363 0772号、米国特許3634253号、米国特許36 42539号、米国特許3687725号、米国特許4 135031号、米国特許4497864号、米国特許 4552794号、アイピーエムテクニカル ディスク ロジャープリテン(IBM Technical Di

sclosure Bulletin) Vol. 9. No7. p779 (1966年12月)、エレクトロニク (ELEKTRONIK) 1961年No12. p38 0、化学便覧, 応用網. p954-957, 1980年 丸替株発行等に記載されている。

【0042】本発明に使用する強磁性粉末又は研磨粉体 の分散剤、分散助剤としては、カプリル酸、カプリン 酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア リン酸、オレイン酸、エライジン酸、リノール酸、リノ レン酸、ステアロール酸、ベヘン酸、マレイン酸、フタ ル酸等の炭素数2~40個の脂肪酸(R₁COOH、R₁ は炭素数1~39個のアルキル基、フェニル基、アラル キル基)、前記の脂肪酸のアルカリ金属(Li、Na、 K、NH:*等) 又はアルカリ土類金属(Mg、Ca、B a等)、Cu、Pb等からなる金属石鹸(オレイン酸・・ 絹)、脂肪酸アミド;レシチン(大豆油レシチン)等が、 使用される。この他に炭素数4~40の高級アルコール (ブタノール、オクチルアルコール、ミリスチルアルコ ール、ステアリルアルコール)及びこれらの硫酸エステ ル、スルホン酸、フェニルスルホン酸、アルキルスルホ ン酸、スルホン酸エステル、燥酸モノエステル、燥酸ジ エステル、燐酸トリエステル、アルキルホスホン酸、フ ェニルホスホン酸、アミン化合物等も使用可能である。 また、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキサイ ド、スルホ琥珀酸、スルホ琥珀酸金属塩、スルホ琥珀酸 エステル等も使用可能である。これらの分散剤は通常一 種類以上で用いられ、一種類の分散剤は結合剤100重・ 量部に対して0.005~20重量部の範囲で添加され る、これら分散剤の使用方法は、強磁性粉末又は研磨粉 体や非研磨微粉末の表面に予め被着させてもよく、また 分散途中で添加してもよい。このようなものは、例えば 特公昭39-28369号、特公昭44-17945 号、特公昭44-18221号、特公昭48-7441 号、特公昭48-15001号、特公昭48-1500 2号、特公昭48-16363号、特公昭49-394 02号、米国特許3387993号、同3470021 号等において示されている.

【0043】本発明に用いる防敵剤としては、2-(4-チアゾリル)-ベンズイミダゾール、N-(フルオロジクロロメチルチオ)-フタルイミド、10・10'-オキシビスフェノキサルシン、2・4・5・6テトラクロロイソフタロニトリル、P-トリルジヨードメチルスルホン、トリヨードアリルアルコール、ジヒドロアセト酸、フェニルオレイン酸水銀、酸化ビス(トリブチル錫)、サルチルアニライド等がある。このようなものは、例えば「微生物災害と防止技術」1972年工学図書、「化学と工業」32、904(1979)等において示されている。

【0044】本発明に用いる帯電防止剤としては、カーボンブラックが使用でき、例えば、ゴム用ファーネス、

ゴム用サーマル、カラー用ブラック、アセチレンブラック等を用いることができる。その比表面積は5~500 m²/g、DBP吸油量は10~400m1/100 g、pHは2~10、含水率は0.1~10%、タップ密度は0.1~1g/cm²であるのが好ましい。このカーボンブラックの具体的な例としては、キャボット社製:BLACKPEARLS 2000、1300、1000、900、800、700、三菱化成工業社製:650B、950B、3250B、850、900、960、980、1000、2300、2400、2600等があげられる。また、カーボンブラックを分散判等で表面処理したり、樹脂でグラファイト化したものを用いることもできる。

【0045】本発明に用いるカーボンブラック以外の帯 電防止剤としては、グラファイト、変性グラファイト、 カーボンブラックグラフトポリマー、酸化錫-酸化アン チモン、酸化錫、酸化チタン一酸化錫一酸化アンチモン 等の導電性粉末;サポニン等の天然界面活性剤;アルキ レンオキサイド系、グリセリン系、グリシドール系、多 価アルコール、多価アルコールエステル、アルキルフェ ノールEO付加体等のノニオン界面活性剤;高級アルキ ルアミン類、環状アミン、ヒダントイン誘導体、アミド アミン、エステルアミド、第四級アンモニウム塩類、ピ リジンそのほかの複素環類、ホスホニウム又はスルホニ ウム類等のカチオン界面活性剤;カルボン酸、スルホン 酸、ホスホン酸、燐酸、硫酸エステル基、ホスホン酸エ ステル、燐酸エステル基などの酸性基を含むアニオン界 面活性剤;アミノ酸類;アミノスルホン酸類、アミノア ルコールの硫酸又は燐酸エステル類、アルキルベタイン 型等の両性界面活性剤等が使用される。

【0046】これら帯電防止剤として使用し得る界面活 性剤化合物例の一部は、特開昭60-28025号、米 国特許2271623号、同2240472号、同22 88226号、同2676122号、同2676924 号、同2676975号、同2691566号、同27 号、同2739891号、同3068101号、同31 58484号、同3201253号、同3210191 号、同3294540号、同3415649号、同34 41413号、 同3442654号、 同3475174 号、 同3545974号、 西独特許公開 (OLS) 19 42665号、英国特許1077317号、岡1198 450号等をはじめ、小田良平他著『界面活性剤の合成 とその応用』(槇書店1972年版); A. W. ベイリ 著『サーフエス アクテイブ エージエンツ』(インタ ーサイエンス パブリケーション コーポレイテッド1 985年版): T. P. シスリー著『エンサイクロペデ ィア オブ サーフエスアクティブ エージェンツ、第 2巻』(ケミカルパブリシュカンパニー1964年

版); 「界面活性剤便覧」第六剧(産業図書株式会社,

昭和41年12月20日): 丸茂秀雄著『帯電防止剤』 幸書房(1968)等に記載されている。

【0047】これらの界面活性剤は単独又は混合して添加してもよい。これらの界面活性剤の使用量は、強磁性粉末又は研磨粉体100重量部当たり0.01~10重量部である。またバック層での使用量は結合剤100重量部当たり0.01~30重量部である。これらは帯電防止剤として用いられるものであるが、時としてそのほかの目的、例えば分散の改良、潤滑性の改良、塗布助剤、湿潤剤、硬化促進剤、分散促進剤として適用される場合もある。

【0048】本発明の分散、混練、塗布の際に使用する 有機溶媒としては、任意の比率でアセトン、メチルエチ ルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ ン、イソホロン、テトラヒドロフラン等のケトン系:メ タノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、イ ソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、メチル シクロヘキサノールなどのアルコール系:酢酸メチル、 酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、酢酸イソプ ロビル、乳酸エチル、酢酸グリコールモノエチルエーテ ル等のエステル系: ジエチルエーテル、テトラヒドロフ ラン、グリコールジメチルエーテル、グリコールモノエ チルエーテル、ジオキサンなどのエーテル系;ベンゼ ン、トルエン、キシレン、クレゾール、クロルベンゼ ン、スチレンなどのタール系 (芳香族炭化水素);メチ レンクロライド、エチレンクロライド、四塩化炭素、ク ロロホルム、エチレンクロルヒドリン、ジクロルペンゼ ン等の塩素化炭化水素、N·N-ジメチルホルムアルデ ヒド、ヘキサン等が使用できる。またこれら溶媒は通常 任意の比率で2種以上で用いる。また1重量%以下の量 で微量の不純物(その溶媒自身の重合物、水分、原料成 分等)を含んでもよい。有機溶媒の代わりに水系溶媒 (水、アルコール、アセトン等) を使用することもでき ъ.

【0049】これらの溶剤は磁性強料又は研磨強料の合計固形分100重量部に対して50~2000重量部で用いられる。好ましい磁性強料又は研磨強料の固形分率は5~60重量%である。

【0050】磁性層又は研磨層の形成は上記の組成などを任意に担合せて溶媒に溶解し、塗布溶液として支持体上に塗布・乾燥する。この磁気配鎖媒体用の非磁性支持体又は研磨テープ用の支持体は可提性を有し、厚みが2~300μm程度である。素材としてはポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル類、ポリプロピレン等のポリオレフイン類、セルローストリアセテート、セルロースダイアセテート等のセルロース誘導体、ポリ塩化ビニル等のビニル系樹脂類、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリアミド、ポリアラミド、ポリスルホン等のプラスチックのほかにアルミニウム、鋼等の金属、ガラス等のセラミックス等も使用で

きる。これらの支持体は塗布に先立って、コロナ放電処理、プラズマ処理、下塗処理、熱処理、除塵埃処理、金属蒸着処理、アルカリ処理を行ってもよい。これら支持体に関しては、例えば、西独特許3338854A、特開昭59-116926号、特開昭61-129731号、米国特許4388368号;三石幸夫著、『繊維と工業』31巻、p50~55、1975年などに記載されている。これら支持体の中心線平均表面租さねは0.001~5.0μmが好ましい。またこれら支持体のヤング率(F5値)は目的に応じて、幅方向、長手方向とも2~30Kg/mm²(1Kg/m²=9.8Pa)を選択することができる。

【0051】分散、混練の方法には特に制限はなく、ま た各成分の添加順序(樹脂、粉体、潤滑剤、溶媒等)、 分散・混練中の添加位置、分散温度(0~80℃)など は適宜設定することができる。磁性塗料又は研磨塗料の 調製には通常の混錬機、例えば、二本ロールミル、三本 ロールミル、ボールミル、ペブルミル、トロンミル、サ ンドグラインダー、ツェグバリ(Szegvari)ア トライター、高速インペラー、分散機、高速ストーンミ ル、高速度衝撃ミル、ディスパー、ニーダー、高速ミキ サー、リボンブレンダー、コニーダー、インテンシブミ キサー、タンプラー、ブレンダー、ディスパーザー、ホ モジナイザー、単軸スクリュー押し出し機、二軸スクリ ュー押し出し機、及び超音波分散機などを用いることが できる。通常分散・混練にはこれらの分散・混練機を複 数備え、連続的に処理を行う。混練分散に関する技術の 詳細は、T. C. PATTON著(テー、シー、パット ン) "Paint Flow and Pigment Dispersion" (ペイント フロー アンド ピグメント ディスパージョン) 1964年John Wiley & Sons社発行(ジョン ウイリー アンド サンズ))や田中信一者『工業材料』25巻 37 (1977)などや当該書籍の引用文献に記載され ている。これら分散、混練の補助材料として分散・混練 を効率よく進めるため、球相当径で10cmタ~0.0 5mm oの径のスチールポール、スチールピーズ、セラ ミックビーズ、ガラスピーズ、有機ポリマービーズを用 いることができる。またこれら材料は球形に限らない。 また、米国特許第2581414号及び同第28551 56号などの明細書にも記載がある。本発明においても 上記の書籍や当該書籍の引用文献などに記載された方法 に準じて迅廉分散を行い磁性強料又は研磨強料を調製す ることができる。

【0052】支持体上へ前記の磁性強料又は研磨強料を 塗布する方法としては、塗布液の粘度を1~20000 センチストークス(25℃)に調整し、エアードクター コーター、ブレードコーター、エアナイフコーター、ス クイズコーター、含浸コーター、リバースロールコーター 、トランスファーロールコーター、グラビアコータ ー、キスコーター、キャストコーター、スプレイコーター、ロッドコーター、正回転コールコーター、カーテンコーター、押出コーター、バーコーター、リップコータ等が利用でき、その他の方法も可能であり、これらの具体的説明は朝倉書店発行の「コーティング工学」253頁~277頁(昭和46.3.20.発行)等に詳細に記載されている。これら塗布液の塗布の順番は任意に選択でき、また所望の液の塗布の前に下塗層あるいは支持体との密着力向上のためにコロナ放電処理等を行っても良い。また磁性層又は研磨層の多層構成は、同時多層塗布、逐次多層塗布等を行ってもよい。これらは、例えば、特開昭57-123532号公報、特公昭62-37451号公報、特開昭59-142741号公報、特開昭59-165239号公報の明細書等に示されている。

【0053】このような方法により、支持体上に約1~ 200μmほどで塗布された磁性塗料又は研磨塗料を必 要により直ちに20~130℃で多段階で乾燥処理を施 した後、形成した磁性層を0.05~3.5µmの厚み に、又は研磨層を0.05~10μmの厚みに乾燥す る。このときの支持体の搬送速度は、通常10m/分~ 900m/分で行われ、複数の乾燥ゾーンで乾燥温度を 20℃~130℃で制御し塗布膜の残留溶剤量を0.1 ~40 mg/m²とする。また必要により表面平滑化加 工を施し、磁性層、研磨層若しくはバック層の中心線平 均表面和さを0.001~0.3µm(カットオフ0. 25mm)とし、所望の形状に裁断したりして、本発明 の磁気記録媒体又は研磨テープを製造する。これらの製 造方法は粉体の子備処理・表面処理、混練・分散、塗布 ·乾燥、平滑処理、熱処理、EB処理、表面研磨処理、 裁断、巻き取りの工程を連続して行うことが望ましい。 【0054】上記平滑処理はカレンダー処理とも呼ば れ、磁性層又は研磨層表面を平滑化することができる。 カレンダーは金属ロール、ナイロンロール、エポキシロ ール等の樹脂ロールが使用できる。処理温度は30~1 00℃、荷重は50~300Kg/cmで行うことが好 ましい、多段で行うと処理が早く完了する。これらは例 えば、特公昭40-23625号、特公昭39-283 68号、特公昭47-38802号、英国特許1191 424号、特公昭48-11336号、特開昭49-5 3631号、特別昭50-112005号、特別昭51 -77303号、特公昭52-17404号、特開昭6 0-70532号、特別平2-265672号、米国特 許第3473960号、米国特許第4728569号、 米国特許4746542号明福書等に示されている。ま た、特公昭41-13181号公報に示される方法はこ の分野における基本的、且つ重要な技術と考えられてい

【0055】磁気記録媒体又は研磨テープは、作製した テープを裁断したあと所望のプラスチックや金属のリー ルに巻き取る。巻き取る直前ないしはそれ以前の工程において研磨テープをバーニッシュ及び/又はクリーニングすることが望ましい。また、磁気記録媒体は、巻き取る直前ないしはそれ以前の工程において前記のような研磨テープによる研磨処理を行い、加えてバーニッシュ及び/又はクリーニングすることが望ましい。

【0056】上記バーニッシュは研磨テープ又は磁気記 録媒体を、具体的にはサファイア刃、剃刀刃、超硬材料 刃、ダイアモンド刃、セラミックス刃のような硬い材料 により研磨面又は磁性面の突起部分をそぎおとし均一に もしくは平滑にする。これら材料のモース硬度は8以上 が好ましいが特に制限はなく突起を除去できるものであ れば良い。これら材料の形状は特に刃である必要はな く、角型、丸型、ホイール(回転する円筒形状の周囲に これらの材質を付与しても良い)のような形状でも使用 できる。また前記クリーニングは、表面の汚れや余分な 潤滑剤を除去する目的でその表層を不識布などでワイビ ングすることにより行う、このようなワイビングの材料 としては、例えば日本バイリーン社製の各種バイリーン や東レ社製のトレシー、エクセーヌ、商品名キムワイ ア、富士写真フィルム社製の各種研磨テープ、また不識 布はナイロン製不満布、ポリエステル製不織布、レーヨ ン製不統布、アクリロニトリル製不統布、混肪不載布な ど、ティッシュペーパー等が使用できる。これらは例え ば特公昭46-39309号、特公昭58-46768 号、特開昭56-90429号、特公昭58-4676 7号、特開昭63-259830号、特開平1-201 824号等にも記載されている。

【0057】本発明に使用される強磁性粉末、研磨粉体、結合剤、添加剤(潤滑剤、分散剤、帯電防止剤、表面処理剤、カーボンブラック、研磨粉体、遮光剤、酸化防止剤、防御剤等)、溶剤及び支持体(下速層、バック層、バック下塗層を有してもよい)或いはその製法に関しては、特公昭56-26890号、特開昭63-259830号等に記載されている製造方法等を参考にできる。

[0058]

【実施例】以下に、本発明の実施例及び比較例を示し、 その特性を評価する。なお、実施例中の「部」は「重量 部」を示す。

【0059】〈実施例1~6〉まず、磁気配録媒体は、下記組成Aで磁性層用塗布液を、下記組成Bで下層塗布液を調整し、厚み3μmのポリアラミドフィルムによる支持体上に、磁性層を0.2μm、下層を0.5μmの厚みとなるように塗布、乾燥した。その後、支持体の裏面にバックコート層を設け、熱処理した後、カレンダー加工し、1/2吋福にスリットし、磁気テープを作製した

【0060】一方、研磨テープは、下記組成Cをサンドグラインダーで均一に混練分散し、粘度調整し、硬化剤

を混入した研磨層用塗布液を、厚さ5μmのポリエステル支持体に3μm厚さとなるようにバーコート塗布し、 乾燥させて研磨層を設ける。上記テープを、19mm幅 にスリットし研磨テープの試料を作製した。

【0061】そして、前記磁気テープの表面を研磨テープによって研磨する。研磨条件は、前記磁気テープを5m/secの走行速度で送りつつ、その磁性層表面に前記研磨テープの研磨層表面を接触させつつ、この研磨テープを磁気テープと逆方向に各種走行速度で走行させて両者の摺動で研磨するものである。その際、前記図1のように磁気テープと研磨テープとの互いの摺接方向を非平行(傾斜角度 θ = 5°)としている。

【0062】各実施例1~4は、下記表1に示すように、研磨テープの研磨層の研磨粉体がダイヤモンドで、研磨テープ走行速度を10~40mm/分に変更したものであり、実施例5は研磨粉体が酸化クロム、実施例6は研磨粉体がアルミナである。

【0063】そして、上記のような各実施例の研磨テープ及び研磨条件によって研磨した磁気テープによるVTR試験を行って、その表面性を評価した測定結果を下記表1に示す。初期磨耗量は、研磨後の磁気テープをVTRで1時間走行させ、VTRヘッドの磨耗量を測定したものである。目詰まり頻度は、研磨後の磁気テープをVTRで2時間走行させ、出力が低下した目詰まり回数を測定したものである。

【0064】
【0064】
【比較例1~3>表1には、比較例1~3の測定結果を併記している。比較例1は、前記磁気テープの磁性面に研磨テープによる研磨を施していない例であり、比較例2及び3は前記研磨テープにより磁気テープに研磨を施す際に、磁気テープと研磨テープとの互いの摺接方向を平行(0=0°)とした例で、研磨テープの走行速度は前記実施例2及び実施例4とそれぞれ同様である。

【0065】表1の結果から、本発明実施例1~6による研磨テープにより研磨した磁気テープでは、初期磨耗量及び目詰まり頻度が小さな値となり、磁気テープ表面の研磨が良好で固定不十分な粒状成分が除去できたものであり、特に研磨テープの研磨粉体がダイヤモンドである実施例1~4において良好な結果が得られている。【0066】これに対し、比較例1では研磨テープによる磁性層表面の研磨を行っていないことで研磨層表面の粒子成分除去がなく、ヘッドの磨耗量が大きく磁性粉末等の脱離によるヘッドの目詰まり回数も多くなっている。また、比較例2及び比較例3では、研磨テープによる研磨を摺接方向を平行として行っていることで、固定不十分な粒子成分の研磨除去が不足し、ヘッド磨耗量はそれ程大きくなくてもヘッドの目詰まりの発生頻度が大きくなっている。

[0067]

[磁性層塗布液組成:A]

強磁性金属粉末 (Fe-Co-Al (Co/Fe:10atm%, Al/Fe:5atm%)、

Hc: 1800 Oe)	100部
結合剤(PKHH:SO3H基をOH基の30%導入)	8部
結合剤 (ポリエステルポリウレタン、スルホン酸基	
3×10-3当量/g、エポキシ基2×10-5当量/g)	6部
結合剤(ポリイソシアネート、トリメチロールプロパン	
(1モル)のTDI(3モル)付加物)	4部
潤滑剤(2エチルヘキシルステアレート/パルミチン酸)	1部
	0.3部
潤滑剤 (オレイン酸オレイル)	
研磨剤(酸化アルミニウム: 粒径0.2μm)	6部
溶 剤(メチルエチルケトン/シクロヘキサノン=2/1)	300部
[下層塗布液組成:B]	
無機粉末 (酸化アルミニウム: 粒径0.2μm)	100部
結合剤(PKHH:SO3H基をOH基の30%導入)	20部
結合剤(ポリエステルポリウレタン、スルホン酸基	
3×10-3当量/g、エポキシ基2×10-5当量/g)	8部
結合剤(ポリイソシアネート、トリメチロールプロパン	
(1モル)のTDI(3モル)付加物)	7部
潤滑剤(オレイン酸銅)	0.3部
[研密層塗布液組成:C]	
研磨粉体(材質:X、粒径0.5μm)	100部
カーボンブラック(キャボット社製コンダクテックスSC)	8部
結合剤(ニトロセルロース樹脂)	6部
結合剤(ポリエステルポリウレタン、スルホン酸基	

3×10⁻³当量/g、エポキシ基2×10⁻⁵当量/g) 10部

結合剤(ポリイソシアネート、トリメチロールプロパン

(1モル)のTDI(3モル)付加物) 4部

分散剤(オレイン酸) 1部

潤滑剤(ミリスチン酸ブチル) 1部

希釈剤(メチルエチルケトン/シクロヘキサノン=2/1) 250部

希釈剤 (キシレン/MIBK/トルエン=1/1/1) 250部

【0068】 【表1】

	研修剤	超動方向	研磨テープ 速度 m/分	ルm 初期 身利量	目割まり頻度 日/2時間
実施例1	1 APP	非平行	10	0. 01	0
実施例2	1 (HE) 1	"	20	0. 02	1
実施例3	F (YE)	"	30	0. 02	0
支施例4	5 (AD).	"	40	0. 02	1
支施例5	製化加	"	25	0. 07	6
実施第6	アルミナ	11	25	0. 08	8
比较例1	-	-	-	0. 20	40
比較男2	F (YEV)	元 平	20	0, 06	15
比较例3	T NOF	平行	40	0. 08	10

【図面の簡単な説明】

1 磁気記録媒体

【図1】研磨テープによる磁気記録媒体の磁性層研磨の

2 研磨テープ

状態を示す機略図

3 パッド

【符号の説明】

θ 角度

(図1)

